特 集 ガラスの溶融と高温物性

ガラス融液の電気化学

1滋賀県立大学客員教授・岡山大学名誉教授 2日本電気硝子株式会社研究部

三浦 嘉也', 紀井 康志'

Electrochemistry of Molten Oxide Glasses

Yoshinari MIURA¹, Yasushi KII²

¹Center for Glass Science and Technology, The University of Shiga Prefecture ²Nippon Electric Glass Co.Ltd.

1. はじめに

酸化物ガラス融液は典型的なイオン性液体で あり、大抵の場合修飾カチオンの輸率が 1 の カチオン伝導体である。それ故電気化学測定が ガラス融液のイオン挙動解明の有力な手段とな るので従来よりガラスの分解電圧の測定,金属 -溶融ガラス界面反応の解明,ボルタンメト リーによるドーパントイオンの redox 反応の 解明などについて研究が進められてきた。ここ ではガラス融液の電気化学の基礎とガラス融液 への電気化学測定法の適用の問題点を概説した 後、サイクリックボルタンメトリーや最近のパ ルスボルタンメトリーによる測定例を紹介す る。さらに電気化学センサーをガラス溶融現場 で使用する試みについて紹介する。

〒678-0232 兵庫県赤穂郡上郡町竹万 1155 TEL 0791-52-2760 FAX 0791-52-2760 E-mail:miuray@bloom.ocn.ne.jp

2. ガラスの電気分解

ガラス融液の電気分解に関する知見はガラス 中のイオン挙動の解明およびガラスの熱力学に おいて重要であるばかりでなく、ガラスの電気 溶融における印加電圧の条件設定など工学的観 点からも必要不可欠である。分解電圧の決定 は、1)可逆電池の起電力測定、2)電流-電位曲 線の測定などの方法がある1,0の方法は熱力 学に則った精確な値が期待できるが、ガルバニ 電池たとえば Na | Na₂O-SiO₂ | O₂ または Si | Na₂ O-SiO₂ O₂ を組み立てる必要があり、高温にお ける電極形成に困難を伴う。不溶性電極を用い てガラスに直流を印加し,得られた電流-電位 曲線から分解電圧を決定する2)の方法は簡便 であるが、得られた分解電圧には理論分解電圧 に電極の材質に依存する分極成分が加わること に留意する必要がある。ところでアノードとカ ソードの2電極を用いて分解電圧を測定する手 法ではトータルの分解電圧を得ることができる が,基準電極がないためにアノード・カソード



図1 Na₂O·9 B₂O₃ および3 Na₂O·7 B₂O₃, 1,000℃ に おける電気分解挙動²。電極は全て白金。

個々の電位に関する情報を得ることができな い。ポテンショスタットを用い白金を参照電極 とした3電極法を用いると個々の電極の情報を 得ることができる。図1はこの方法で得られた 定常電流 – 電位曲線の一例である²⁰。

xNa₂O・(10-x)B₂O₃系ガラス融液,1,000℃ において白金作用電極の電位を参照電極に対し てステップ状に印加し定常電流を得た。カソー ド側ではいずれの組成でも-1.2V付近までの 電圧印加に対する電流応答は小さいが,これよ り負電位で急激な電流増加が認められる。一方 アノード側ではおおよそ0.2Vより正電位側で 電流が増加している。それ故トータルな分解電 Eは大略1.4Vである。電気分解後のカソード の元素分析によれば、ホウ素の析出が確認され ておりホウ素イオンが還元され白金ホウ化物合 金を作ると想定された。アノードでは酸素発生 が確認された。図2は透明石英坩堝を用いて電 気分解の様子をその場観察したものである²。

(c) 図は 2 Na₂O · 8 B₂O₃, 1,000 ° において作 用電極(T)を 0.3 V でアノード分極させた場合 であるが連続的な酸素ガスの発生が見られる。 同じ条件で作用電極(T)を-1.65 V でカソード 分極させた場合((a) 図)には補助電極(A)に 酸素ガスの発生が見られる。ホウ素原料に H₃ BO₃を用いた仕込み組成 2 Na₂O · 8 H₃BO₃ ガラ スを 1,000 ° で作用電極(T)を-1.60 V でカ ソード分極させた場合((b) 図)には作用電極 (T)および補助電極(A)両方から気泡発生が認 められる。作用電極での気泡は水素であり残留 水分の電気分解が起こっている。

ホウ酸塩系以外の酸化物ガラスの電気分解で もアノード側の分解挙動は組成によって大きく は異ならない³⁰。しかしカソード側の分解挙動 は網目形成酸化物に依存する。白金電極での還 元され易さは、(易) P>Al>Si>B(難)の順で あり、それぞれの還元析出電位は、P:-0.7 V、Al:-0.85 V、Si:-1.1 V、B:-1.2~-1.4 Vと想定された³⁰。



図2 アルカリホウ酸塩,1,000℃における電気分解中の電極の様子²。(a)作用電極(T)を-1.65 Vでカソード分極した時(2 Na₂O・8 B₂O₃ 中)。(b)作用電極(T)を-1.60 Vでカソード分極した時(2 Na₂O・8 H₃B₂O₃ 中)。(c)作用電極(T)を 0.3 Vでアノード分極した時(2 Na₂O・8 B₂O₃ 中)。A:補助電極, R:参照電極。

3.金属一酸化物ガラス融液界面の電気 化学反応

金属など電子伝導体と電解質であるガラスが 高温で接すると何らかの化学変化が起こり電圧 印加によって電気化学反応が随伴する。金属 Mが酸化物ガラス融液と接触した時に考えら れる主な電気化学反応は,

- 1. アノード反応として
 - 1) Mのアノード溶解; M→Mⁿ⁺+ne⁻
- 2) 不導体皮膜の形成; M+X⁻→MX+ ne⁻
- 3) 酸素ガスの発生; O²→1/2 O₂+2 e⁻
- 2. カソード反応として
- ガラス構成カチオンの還元析出と合 金形成;
 - たとえば、B³⁺+3e→B, Si⁴⁺+4e⁻ →Si, Pb²⁺+2e→Pb
- 溶解した Mⁿ⁺イオンの還元, 化合物 MX の還元;

 $M^{n+}+ne^{-} \rightarrow M, MX+ne^{-} \rightarrow M+X^{n-}$

- 3) 交換反応;たとえば、M + n/2Pb²⁺
 →Mⁿ⁺+n/2Pb
- ガラスに微量添加物が含まれる場合にはこれ



図3 16 Na₂O・12 CaO・72 SiO₂, 1,400[°]C における Mo カソードの電位走査法による電流 - 電位曲線⁴⁾。

らの反応以外に様々な酸化還元反応や交換反応 が想定できる。

測定例を一例だけ示す。図3は16 Na₂O・12 CaO・72 SiO₂, 1,400℃において白金を参照電 極と補助電極に用い三角波ポテンシャルスイー プ法でモリブデン作用電極をカソード分極した 時に得られた電流 – 電位曲線である⁴。

何の変哲もない電流 - 電位曲線であるが電位 走査速度を1V/s, 0.1V/sと遅くするとある 電位で不導体皮膜が形成されてポテンショスタ ットが制御不能となった(図中の破線)。分極 後の電極の EPMA 分析からモリブデンシリサ イドと考えられる反応層の存在が認められた。 一方アノード分極ではモリブデン酸化物生成に よる電流ピークが認められた。

前川らは Sb イオンを含むアルミノケイ酸塩 ガラス融液中での Mo の電気化学的腐食を調べ Sb イオンの影響や交流周波数依存性を議論し ている⁵⁾。

8.酸化物ガラス融液でのボルタンメト リー

4-1. ボルタンメトリーの概略

ガラス融液中の微量ドーパントイオンの電極 反応, redox 反応および物質移動過程を in situ で評価するのに適した電気化学手法がボルタン メトリーである。

電解系に電流が流れた時には次のような諸過 程が考えられる。

 1)電極・溶液界面(電極反応層)での電極反応
 2)電極面に隣接した物質移動層中での電極反応 物質の電気化学的移動

3) 溶液層内部での全イオンによる電気的泳動

イオンの移動の駆動力は電気化学ポテンシャ ル $\tilde{\mu}$ の勾配である⁶。イオンiの電気化学ポテ ンシャルを $\tilde{\mu}_i$ (= μ_i + $z_i F \varphi$, ここで μ_i :イオン iの化学ポテンシャル, $z_i F$:iの1 molの電荷, φ :内部電位)とすると,イオンiのflux J_i は,

$$J_{i} = n_{i}v_{i}\left(\frac{-d\widetilde{\mu}_{i}}{dx}\right) \qquad (1)$$

ここで, *n*_i:iの濃度, *v*_i:iのx方向への移動速 度 (*dx/dt*)

イオンiの移動によって流れる電流密度 Ii は、

$$I_{i} = z_{i} F n_{i} v_{i} \left(\frac{-d\widetilde{\mu}_{i}}{dx} \right)$$
$$= z_{i} F n_{i} v_{i} \left(\frac{-d\mu_{i}}{dx} \right) + z_{i}^{2} F^{2} n_{i} v_{i} \left(\frac{-d\varphi}{dx} \right)$$
(2)

全電流 I は(2)式の第1項のイオンiの化学ポ テンシャル勾配による拡散電流と第2項の電位 勾配による泳動電流の和である。特殊な場合と して,極めて少量のイオンiが大過剰の無関係 電解質(支持電解質)中で移動する場合にはイ オンiのイオン環境は常に一定に保たれている と考えられるので,活量係数を一定とみなすこ とができる。またイオンの移動によって生じる 微視的な電場の影響も無視できる。したがって イオンiのflux は,

$$J_{i} = n_{i}v_{i}\left(\frac{-d\widetilde{\mu}_{i}}{dx}\right) = n_{i}v_{i}\left(\frac{-d\mu_{i}}{dx}\right)$$
$$= -n_{i}v_{i}RT\left(\frac{d\ln a_{i}}{dx}\right) = -n_{i}v_{i}RT\left(\frac{d\ln n_{i}}{dx}\right)$$
$$= -v_{i}RT\left(\frac{dn_{i}}{dx}\right) = D_{i}\left(\frac{-dn_{i}}{dx}\right)$$
(3)

ここで, *a*_i:イオンiの活量, *n*_i:iの濃度, *D*_i:iの拡散係数

(3)式から明らかなように支持電解質中での微量 イオンの移動は,拡散のみで行われることにな り電場の影響を受けない。

酸化物ガラス融液はアルカリ金属イオンやア ルカリ土類イオンなど修飾カチオンの輸率が1 であり、これらカチオンはガラス構成イオンと して多量に存在しており、支持電解質としての 役割を担っている。それ故微量のドーパントイ オンの移動は濃度勾配による拡散のみである。

このようにアルカリ金属イオンなど修飾カチ オンを多く含む酸化物ガラス融液中のドーパン トイオンのイオン挙動をボルタンメトリーで解 析することは電気化学理論に則っている。しか し無アルカリ系ガラスや修飾酸化物の少ないガ ラスでは溶融温度が高い・ドーパントの溶解度 が小さいなどの測定上の困難以外に、カチオン の易動度が小さいために、ドーパントイオンの 移動は拡散以外に泳動を伴う度合いが大きくな り、ボルタンメトリー適用の理論前提が危うく なる可能性があり、データの解釈に注意払う必 要がある。

4-2. ガラス融液へのボルタンメトリー適用 の問題点と留意事項

高温を必要とするガラス融液へのボルタンメ トリーの適用には多くの困難と限界が存在す る。そのひとつは参照電極の選定であり,作用 電極の材質にも配慮する必要がある。またガラ ス融液の"電位窓の広さ"に関する情報も重要 である。

(1) 参照電極

参照電極には電位が安定であること・再現性 のあることに加えて,種々の組成の融液および 温度について相互換算性があることが要求され る。水溶液ではカロメル電極のようにこれらの 条件を満たす参照電極があるが,高温を必要と するガラス融液では基準融液と液絡を作る方法 が技術的に作製困難であること,さらに基準融 液の選定の任意性のために電位の相互換算性を 犠牲にして,電位の安定性・再現性の観点のみ で参照電極を選定し,特定のガラス系ごと・測 定温度ごとに作用電極電位を決めているのが現 状である。

それ故各種ドーパントイオンの redox 電位 を同一組成のガラス融液・同一温度で比較する のは意味があるが,ガラス組成が異なる場合や 異なる温度での値を単純に比較するのは理論的 な意味を持たない。また電極電位から熱力学諸 量を算出し組成や温度依存性を議論している論 文が散見されるが,同じ理由で理論的根拠が薄 弱であると言わざるを得ない。

珪酸塩ガラス融液で、安定化ジルコニア、酸 化錫、白金などの参照電極特性を最初に調べた のは Plumat らである⁷⁾。1,100[°]C において安定 化ジルコニア電極 Pt·O₂(1 atm) $|ZrO_2(MgO)|$ および酸化錫電極 Pt·SnO₂, O₂(0.2 atm) | の電 位は1時間以内で安定化し10 mV 以内の再現 性を示した。しかし高温ではガラス融液による 侵食を免れることはできない。白金電極 Pt·O₂ (0.2 atm) | は安定化に4時間近くを要し再現性 も前二者に比較してやや劣るが,高温でも使用 でき化学的に安定であるという利点を有してい る。Rüssel の研究グループや Schott の研究者 らはもっぱら安定化ジルコニア電極を使用して いる^{8.9)}。CaO や MgO で安定化させたジルコニ アは,ガラス中のこれらイオンとの反応によっ て容易に侵食されるが,Y₂O₃ で安定化させた (ZrO₂) 0.955 (Y₂O₃) 0.045 は比較的耐侵食性が高 い⁹⁾。

一般的には取り扱いの簡便な純白金を参照電 極として使っている。白金電極は酸素電極反 応、 $O^2(m) = 1/2 O_2(m) + 2 e^-, O_2(m) = O_2(g)$ (ここでmは融液中,gは気相)をすると想定 しているので,気相・金属・融液3相の接触面 積が大きくなるように白金線は波状に折り曲 げ,波状の中間まで液に浸漬させ電位の安定化 を図っている場合が多い¹⁰。

(2) 作用電極

水溶液系のポーラログラフィーでは作用電極 として滴下水銀電極を使用する。電極は液体な ので電解質に接している電極面は常に清浄表面 を保ち,電気化学理論が厳格に適用できる。し かしガラス融液では(滴下)液体電極は技術的 に困難であり,固体電極を使用せざるを得な い。固体電極としてはガラス融液中での安定 性・非反応性の観点から主として白金を使用す ることになるが,カソード反応の場合には電解 生成物と反応したり合金を作ることがままあ る。電解生成物が液体または気体の場合には, 時間の経過とともに電極から離脱して電極の表 面状態は旧に復すことになるが, 電解生成物が

固体の場合には電解時間の経過とともに電極表 面状態は変化し、電極電位は初期電位からずれ てしまう。このような場合には測定ごとに新鮮 表面をガラス中に浸漬できるような実験上の工 夫をするとともに,印加電位の低減・電位印加 時間の短縮化に工夫する必要がある。昨今の主 流であるパルスボルタンメトリーは電気二重層 の充電電流の影響を極小にすることができるの で高感度測定が可能であるが,それ以外に測定 時間の縮減に役立っている。不純な白金を作用 電極に使用すると,混合電位を示したり局部酸 素濃淡電池ができたりするので白金の純度に留 意すべきである⁹。

(3) 補助電極

ポテンショガルバノスタットを用いてボルタ ンメトリー測定を行う場合、作用電極電位を参 照電極に対して規制しながら作用電極と補助電 極間の電流を測定し,得られた電流-電位曲線 を解析する。補助電極は電流に対する安定性が 大きく,電流が多少流れても電位変動せず電流 変化はすべて作用電極に帰着できる状況が望ま しい。そのためには作用電極に比べて表面積が 十分大きな非分極性電極を用いる必要がある。 安定性の観点から白金を用いることになるが、 面積を大きくとった白金板を用いるかまたは白 金坩堝を補助電極とするのが現実的である。し かし(2)式の拡散電流は半無限線形拡散を前提に している。白金線を作用電極, 白金坩堝を補助 電極とする電極配置では物質移動は巨視的には 円筒拡散で行われており、理論からずれる可能 性について検討しておく必要がある。

(4) 酸化物ガラス融液の"電位窓"の広さ

ドーパントイオンを含まない支持電解質が電 子授受をせずに単に電気二重層の充電電流のみ が流れ,理想分極性電極として振舞う電位範囲 を電位窓というが,電位窓のカソード側は支持 電解質や不純物の還元され易さで決まる。他方 電位窓のアノード側は支持電解質や不純物の酸 化または電極のアノード溶解で決まる。

白金電極と酸化物ガラス融液で形成される電 気化学系では、多量に含まれている修飾カチオ ンの泳動電流が大きいのが特徴である。カソー ド電位が大きくなるにつれ、比較的低電位から ガラス構成成分の還元析出が起こる。カソード 電流が急激に増加し始める電位は、白金電極基 準でおおよそ-1V前後であり電位窓は比較的 狭い。電位窓内でも充電電流は大目であり、 ドーパントイオンの還元電位が卑な場合にはバ ックグラウンドに隠れて電極電位の精度の高い 決定を困難にする。この場合、ボルタモグラム のバックグラウンド補正を考える必要がある。

アノード側では白金電極基準でおおよそ 0.2 V前後からアノード電流が急激に増加し,ガラ スや含まれている水分の分解による酸素発生に 至る。アノード側電位窓は極めて狭いのでドー パントイオンのアノード反応を調べるのは極め て難しい。

4-3. ボルタンメトリーの分類と測定例

電気化学で測定できるものは、電位(E)、電 流(i)、時間(t)および電極反応関与物質の濃度 (C)であることを念頭においてボルタンメト リーを分類すると、電位規制法、電流規制法に 大別され、また時間項を考慮するかどうかで定 常法と非定常法に分かれる(詳細は紙数の制限



図4 28.7 Na₂O·71.3 B₂O₃, 850℃ における Cd²⁺イオ ンの還元方向のボルタモグラム¹²⁾。

のため成書にゆずる¹¹⁾)。電位規制法の内最も ポピュラーな手法がサイクリックボルタンメト リー (CV 法,電位走査法)である。その一例 を図4に示す¹²⁾。

28.7 Na₂O·71.3 B₂O₃ に微量添加した Cd²⁺ イ オンの 850[°]C における還元電流 – 電圧曲線であ るが、電流ピークは電位走査速度に依存してお らず電極反応は可逆であることを示している。 ピーク電位 E_p から Cd²⁺ + 2 e⁻ = Cd の電極反応 の標準電位に相当する半波電位 $E_{1/2}$ を、 $E_p = E_{1/2}$ -1.11 *RT/nF* によって決定できるので、種々の ドーパントイオンの還元され易さの序列(電気 化学列)を決定することができる。

しかし電位走査法で電位が時間とともに変わ ると、電気二重層の充電を伴いながらドーパン トイオンの電子授受反応が進むので、求めたい ファラデー電流成分が充電電流の陰に隠れて分 離困難となり、分析可能イオン種が限られると ともに測定精度も良いとは言えない。

その後発達した電位をステップ状に変える方 法では、電気二重層の充電は電位ステップの初 期に終わってしまうので、以後の電流はファラ デー成分のみとなり測定精度は飛躍的に良くな る。Rüssel や愛媛大学の前川のグループは各 種のパルスボルタンメトリーを用いてドーパン トイオンの redox 反応を精力的に研究してき た^{8,13-15}。これらを含めた最近の研究例を以下に 示す。

図5は16 Na₂O·10 CaO·74 SiO₂に微量添加 したFe イオンの1,100℃における電流-電圧



図 5 16 Na₂O・10 CaO・74 SiO₂ + 1 Fe₂O₃ (mol %), 1, 100℃ におけるボルタモグラム¹⁶⁾。 a) CV 法, b) SWV 法。

NEW GLASS Vol. 24 No. 4 2009

曲線であり, a) は CV 法, b) は矩形波ボルタ ンメトリー (SWV 法) を用いた測定結果を示 している¹⁶⁾。CV 法では上述した充電電流の影 響によってピークが不明瞭であるが, SWV 法 ではピークが鮮明になっている。

近年,上述のSWV法や微分パルスボルタン メトリー (DPV法)を用いて,清澄剤として 使用されるSb⁵⁺イオン,As⁵⁺イオンやガラス 中の不純物であり着色に影響を及ぼすFe³⁺イ オンなどの酸化還元の序列が明らかにされてき た¹³⁻¹⁸⁾。図6はRüsselらがSWV法を用いて測 定したリン酸ガラス中のドーパントイオンの ピーク電位 E_p の温度依存性の評価例であ る¹⁷⁾。図中の上に位置するほど還元されやすい イオン種であることを示す。

ボルタンメトリーでは半波電位 $E_{1/2}$ を用いて 添加した微量イオンの酸化体と還元体の比 (redox 比)を見積もることができる¹⁸⁾。SWV で はピーク電位 E_p は $E_{1/2}$ と等しくなり¹⁹⁾,いくつ かの仮定を踏まえると $E_{1/2}$ は次式で与えられ る¹⁵⁾。

$$E_{1/2} = \frac{RT}{nF} \ln \frac{[\text{Red}]}{[\text{Ox}]} \qquad (4)$$

ここで[Red]/[Ox]は添加した微量イオンの



図6 NaPO₃・2 Si (PO₃)₂ 中の各種 redox イオンのピー ク電位と温度の関係¹⁷⁾。Line 1:Sb³⁺/Sb⁰, line 2: Sb⁵⁺/Sb³⁺, line 3:As³⁺/As⁰, line 4:As⁵⁺/As³⁺, line 5:Cu²⁺/Cu⁺, line 6:Fe³⁺/Fe²⁺, line 7:S⁴⁺/S⁰。

redox 比である。Redox 比は、たとえば次式で 示される清澄反応(酸化体 Ox が還元体 Red になり O₂ ガスを放出する反応)の O₂ ガス放出 温度域や放出ガス量を知る一つの指標となる。

 $Ox + nO^{2^{-}} = \operatorname{Red} + \frac{n}{2}O_2 \qquad (5)$

図7に吉田らが DPV 法を用いて行ったソー ダ石灰ガラスにおける Sb と As の redox 比に 関する研究例を示す²⁰⁾。Sb は 1,000 \mathbb{C} 付近か ら O_2 ガスを放出するのに対し, As は 1,400 \mathbb{C} 付近から O_2 ガスを放出することが分かり,電気 化学測定が in situ 測定に適していることを示 唆する結果である。

このようにボルタンメトリーで得られるピー ク電位は、ガス放出温度域などの清澄挙動を理 解する上で有用な情報を与える。しかしこれら の情報を得るためには、得られたピークが如何 なる酸化還元反応に起因するピークかを同定し なければならない。たとえば Sb⁵⁺から Sb³⁺へ の還元反応を利用する清澄現象について考察す るためには、観察しているピーク電位が Sb⁵⁺



図7 16 Na₂O·10 CaO·74 SiO₂+0.1 M₂O₅ (M=Sb or As) における Sb³⁺および As³⁺の redox 比と温度 の関係²⁰⁾。



図 8 16 Na₂O・10 CaO・74 SiO₂, 1,200℃, P(O₂) = 1.013×10⁵Paにおける典型的なボルタモグラ ム¹³⁾。実線:0.5 mol%の Sb₂O₃を含む (ブラン ク減算処理後),点線:理論曲線。

からSb³⁺への還元反応に対応していることを 別の手段で示さなければならない。一般的に行 われている確認方法は,J.Osteryoungらによ って提案された"理論曲線"と比較する方法で ある^{13,15,18,19)}。図8は前川らがSb⁵⁺イオンとSb³⁺ イオンの還元ピークを理論曲線と比較し移行電 子数を特定した例である¹³⁾。図中の2つのピー ク (Peak 1, Peak 2) はそれぞれ2電子反応,3 電子反応に起因するピークであると結論付けら れ,それぞれSb⁵⁺→Sb³⁺,Sb³⁺→Sb⁰の還元反 応に帰属できた。その他のイオン種についても 同様の手法でピークの帰属が試みられており, Rüsselと前川らの同一イオンでの測定結果は 概ね一致している^{15,18)}。

しかし、ピークに対する redox 反応の帰属 の見解が研究者間で一致しないケースが存在す る。その代表例は硫黄である。ガラス融液中に おいて硫黄種は、S⁶⁺(SO₄²⁻)、S⁴⁺(SO₂もしくは SO₃²⁻)、S⁰、S²⁻で存在すると考えられ、研究者は おのおの得られたボルタモグラムを理論曲線と 比較してピークの帰属を試みているが、その結 論は一致していない²¹⁻²⁴⁾。これは硫黄種の反応 が、ガス(SO₂)が関与する SO₄²⁻⇔SO₂ や SO₂ ⇔S⁰ のような不可逆酸化還元反応であるた め、基本的に可逆反応を前提としている理論曲



図9 14 Na₂O·10 CaO·76 SiO₂, 1, 300℃ におけるボ ルタモグラム²⁵⁾。実線:0.2 mol%Na₂SO₄を含む 場合,点線:ブランク。

線が適用できないことに起因する。

そこで筆者(紀井)は理論曲線と比較する方 法ではなく別の方法で SO⁴²⇔SO²反応の帰属 を試みた²⁵⁾。SO₄²⇔SO₂反応は還元方向に電位 を挿引する場合, SO2 が発生する2電子反応で あることに着目し、ボルタンメトリー測定中の 電極をその場観察した。ソーダ石灰ガラスでは 1,300℃において peak 2のある-500 mV 付近 (図9参照)で泡が発生することを確認すると ともに質量分析によってこの泡のガス成分が SO2であることを明らかにした。また定電位に 保持したときに発生する SO₂ ガスをその場観 察し電気量と発生ガス量の定量関係を検討し た。ファラデー則から反応電子数を約2と決め ることができ peak 2 を SO₄²⇔SO₂ 反応と特定 できた。図10にガス発生の電位依存性をその 場観察した一例を示す。-500 mV 付近から顕 著な泡発生が観察された。

ドーパントイオンの挙動が多く研究されてい るガラス系はソーダ石灰ガラスや Na_2O -SiO₂ ガラスなどである。最近は E ガラスや液晶用 板ガラスに代表される無アルカリ系ガラス(た とえば CaO-B₂O₃-Al₂O₃-SiO₂ ガラス や CaO-BaO-Al₂O₃-SiO₂ ガラス)に対する研究例も見 られるようになってきているが²⁶⁻²⁸, まだその

NEW GLASS Vol. 24 No. 4 2009







数は多くはない。これは無アルカリ系ガラスの 電気伝導度が小さいこと,ドーパントイオンの 溶解度が小さいこと,溶融温度が高温であるこ となどの技術的困難のためと考えられるが,今 後電気化学測定系に工夫を凝らしこの方面の研 究がさらに発展することが期待される。

電気化学センサーのガラス製造現場 での適用例

ガラス製造プロセスの技術的課題として消費 エネルギーの削減や環境負荷物質(Sb, As な ど)の低減と代替が挙げられる。消費エネルギー を削減する一つの手段として,生産炉における ガラス融液中のSb イオンや As イオンの酸化 還元状態をリアルタイムで測定し,酸化還元状 態を制御することによって清澄の効率化を図る 方法が考えられる。実際に、タンク炉中のガラ ス融液に含まれる多価金属イオンの redox 比 をボルタンメトリーを用いて測定した例がいく つか報告されている²⁹⁻³¹⁾。しかし電気化学セン サーとして信頼でき実用化が図られるために は、参照電極電位に影響を及ぼす雰囲気酸素分 圧や参照電極の浸漬深さを制御する方法やガラ ス融液中の酸素イオン活量を見積もる方法など 技術的に検討すべき課題が残されている。

他方,上記の redox fining に代わる環境負荷 物質低減法として electrolytic fining が提案さ れている³²¹。この方法はメルター底面に設置し た fining electrode (アノード)と融液表面に 設置した counter electrode (カソード)間に 電位をかけることによって,アノードで O_2 を 発生させ,一方のカソードで O_2 を吸収させる 反応を利用した清澄技術である。アノードで発 生する O₂ 泡はガラス融液中の微小泡と合体拡 大し清澄を促進させる。この方法では電極間に 印加する電圧を高くするに従い,アノードでは 白金電極が酸化されカソードではシリコンイオ ンの還元反応が生じるので,電圧印加を参照極 を用いてアノードおよびカソードそれぞれでこ れらの反応が起こらない範囲に制御する必要が ある³²⁾。電位制御を精密に行うためには各種 ドーパントイオンの電極電位への影響を知る必 要があるが,これらの値はソーダ石灰ガラスな ど一部のガラス系で研究されるに留まっている のでさらに検討を要する技術であると言える。

6. おわりに

著者のひとり(三浦)が約40年前にガラス 融液の電気化学測定を始めた頃はポテンショス タットは高価で手に入れることは難しかった。 そこでクロノポテンショメトリー用の定電流電 源を自作し,X-Yオシログラフで電位-時間 曲線を写真撮影しドーパントイオンの還元電位 や拡散挙動を調べたが,データの信頼性は低く ガラス融液に電気化学手法が適用可能であるこ とを示しただけの意義しかなかった。また当時 のポテンショスタットもマニュアル制御であ り,記録計で紙の上にボルタモグラムを描かせ る方式であったので,速い過渡応答測定は困難 であったので,かなりの測定誤差が見込まれ た。

その後パソコンで制御できるデジタルポテン ショガルバノスタットが開発され,またパルス 法が普遍的に使えるようになって,ガラス融液 特有の大きな充電電流の低減化が図れたので測 定可能イオン種は増え測定精度も飛躍的に向上 した。しかしパルス法でも如何ともしがたいの はガラス融液の電位窓の狭さであり,イオン挙 動が解明できるイオン種にはなおも限界がある のが現状である。バックグラウンド補正法の改 良でこの隘路が拡がりさらに電極に関する諸課 題が解決したならば,電気化学測定の最大の特 徴はin situ 測定ができ測定情報をリアルタイ ムでフィードバックできる点にあるので,ガラ ス清澄プロセスの電気化学センサー制御の可能 性が生じ,溶融プロセスの効率化のみならず省 エネルギー・省資源・環境保全に大きく貢献す ると期待できる。

他方, 無アルカリ系ガラスや修飾カチオンの 少ないガラス系での redox fining のボルタンメ トリーによる研究が要請されているが,項目 5 に書いたような技術的課題があり格段の工夫が 必要となる。たとえばマイクロ電極の採用によ って高感度化を図ったり,オーミックドロップ 補正法を考える必要があろう。

別の電気化学的課題としてガラス融液内で発 生する熱起電力の理論的解明が要請されてい る。ガラス製造プロセスは大きな温度勾配下に あるのでガラスには熱起電力が発生している が,ガラス組成・温度差・容器の材質などの影 響が明確になっているとは言えず系統的研究が 必要である。これも電気化学的に解明すべき課 題であるが今回は言及できなかった。関心のあ る向きは文献³³を参照されたい。

参考文献

- IU. K. Delimarskii and B. F. Markov, "Electrochemistry of Fused Salts", pp. 123–158, Sigma Press Pub., (1961).
- 2)三浦嘉也,秋山幸徳,高橋克明,窯業協会誌,94,425 (1986).
- 3)三浦嘉也,稲生正行,高橋克明,窯業協会誌,94,491 (1986).
- 4) 三浦嘉也,高橋克明,浅田雅之,山崎隆太郎,材 料,33,1085 (1984).
- 5) M. Yamamoto, K. Sakai, R. Akagi, M. Sakai, H. Yamashita and T. Maekawa, *J. Ceram. Soc. Japan*, **112**, 179 (2004).
- たとえば、玉虫伶太、「電気化学(第2版)」(東 京化学同人), pp.67-73 (1991).
- 7) E. Plumat, F. Toussaint and M. Boffe, *J. Am. Ceram.* Soc., 49, 551 (1966).
- 8) C.Rüssel, "Redox Behavior and Electrochemical Behavior of Glass Melts"

("Properties of Glass-Forming Melts" ed. by L. D. Pye, A. Montenero and I. Joseph, Taylor&Francis,

NEW GLASS Vol. 24 No. 4 2009

(2005).

- 9) Friedrich G. K. Baucke, "Electrochemistry of Glasses and Glass Melts, Including Glass Electrodes", pp. 304–313, (ed. by H. Bach, Friedrich G. K. Baucke and D. Krause, Springer, (2000).
- 10) たとえば、高橋克明、三浦嘉也、窯業協会誌, 87, 94 (1979).
- 11) 電気化学会編,「電気化学測定マニュアル(基礎 編)」(丸善), pp.74-141 (2002).
- 12) K. Takahashi and Y. Miura, J. Non-Cryst. Solids, 80, 11 (1986).
- 13) H. Yamashita, S. Yamaguchi, R. Nishimura and T. Maekawa, *Anal. Sci.*, **17**, 45 (2001).
- 14) R. Nishimura, H. Yamashita and T. Maekawa, J. Ceram. Soc. Japan, 111, 723 (2003).
- 15) S. Itoh, H. Yamashita and T. Maekawa, *J. Ceram. Soc. Japan*, 112, 110 (2004).
- 16) E. Freude and C. Rüssel, *Glastechn. Ber.*, 60, 202 (1987).
- 17) A. Matthai, O. Claußen, D. Ehrt and C. Rüssel, Glastechn. Ber. Glass Sci. Techn., 71, 29 (1998)
- 18) D. Benne and C. Rüssel, *Glastech. Ber. Glass Sci. Techn.*, 76, 130 (2003).
- 19) J. Osteryoung and J. J. O'Dea, *Electroanalytical Chem.*, 14, 209 (1986).
- 20) S. Yoshida, T. Sudo, M. Kato, T. Sugawara, J. Matsuoka, Y. Miura and Y. Kii, J. Non-Cryst. Solids, (投

稿中).

- 21) T. Kordon, C. Rüssel and E. Freude, *Glastechn*. *Ber*., 63, 213 (1990).
- H. Yamashita, S. Yamaguchi, M. Yokozeki, M. Nakashima and T. Maekawa, J. Ceram. Soc. Japan, 107, 895 (1999).
- 23) B. LaFage and P. Taxil, J. Electrochem. Soc., 140, 3089 (1993).
- 24) R.G.C. Beerkens, J. Am. Ceram. Soc., 86, 1893 (2003).
- 25) Y. Kii, M. Kawaguchi, T. Futagami, S. Aoki, S. Yoshida, M. Kato, T. Sugawara, J. Matsuoka and Y. Miura, J. Non-Cryst. Solids, (投稿中).
- 26) M. Yamamoto, Abstract of 21st ICG, I-48 (2007).
- 27) Gordon von der Gonna and C. Rüssel, J. Noncryst. Solids, 288, 175 (2001).
- 28) Gordon von der Gonna and C. Rüssel, J. Noncryst. Solids, 306, 263 (2002).
- H. Muller-Simon and M. Szafarczyk, Ber. Bunsenges. Phys. Chem., 100, 1484 (1996).
- 30) M. Zink, C. Rüssel, H. Muller–Simon and K. W. Mergler, *Glastechn. Ber.*, 65, 25 (1992).
- H. Muller–Simon and K. W. Mergler, *Glastechn*. Ber. Glass. Sci. Techn., 68, 273 (1995).
- 32) 文献 9)の pp. 359-364.
- 33) 文献 9)の pp. 367-384.